

МОСКОВСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ИНСТИТУТ
(ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)

Лабораторная работа
«Исследование отражательного клистрона»

Москва, 2006 г.

Теоретические сведения

Очень важной разновидностью кластронов является отражательный кластрон. Отражательные кластроны используются в качестве генераторов маломощных СВЧ - колебаний в измерительной аппаратуре, радиолокационных и других приемных устройства.

В отличие от пролетного кластрона отражательный кластрон имеет один резонатор, который одновременно модулирует поток электронов, летящих от катода к отражателю, и отбирает энергию от отраженных электронов.

Важнейшими преимуществами отражательного кластрона (рисунок 1) являются простота схемы питания и устройства, наличие электронной перестройки и широкий диапазон механической перестройки генерируемой частоты.

В вакуумном баллоне отражательного кластрона располагаются катод, ускоряющий электрод, объемный перестраиваемый резонатор, сетки которого пронизывает электронный поток. На некотором расстоянии за сетками резонатора расположен отражатель, на который подается отрицательное напряжение порядка $U_{OTR} = - (100 \dots 300)$ В. Пространством дрейфа здесь является объем заключенный между резонатором и отражателем.

Принцип действия отражательного кластрона.

Поток электронов, эмитируемых катодом, разгоняются полем ускоряющего электрода, проходит через сетки резонатора. В резонаторе наводятся слабые колебания (эти начальные колебания возникают от неравномерности, флуктуации электронного потока, эмитируемого катодом). Под действием этих колебаний электронный поток модулируется по скорости. Пролетев сетки резонатора в одном направлении (как было сказано выше с разными скоростями), электроны тормозятся полем отражателя, при этом происходит их группировка, и возвращаются назад полем отражателя уже в виде сгустков.

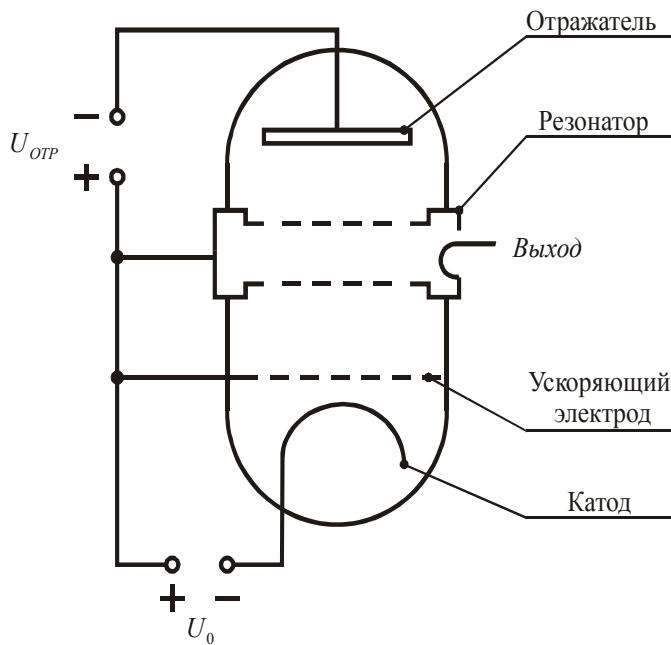


Рисунок 1. Устройство отражательного кластрона.

Внешний вид кластрона приведен на рисунке 2.

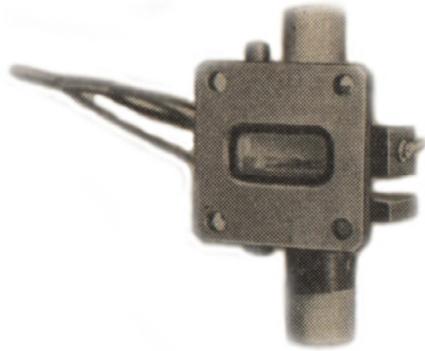


Рисунок 2. Внешний вид кластрона.

Группировка происходит относительно невозмущенных электронов (пролетевших через резонатор в момент t_2 на рисунке 3, когда в нем $E_{рез} = 0$). Электрон, вышедший раньше (t_1 на рисунке 3) и имеющий большую скорость, проникает в тормозящее поле отражателя глубже, следовательно, летит дальше невозмущенного и может вернуться в зазор резонатора почти одновременно вместе с ним. Электрон, вышедший позже невозмущенного электрона (t_3 на рисунке 3) и имеющий меньшую скорость,

проникает в тормозящее поле на меньшее расстояние, и велика вероятность, что он вернется в резонатор вместе с невозмущенным электроном.

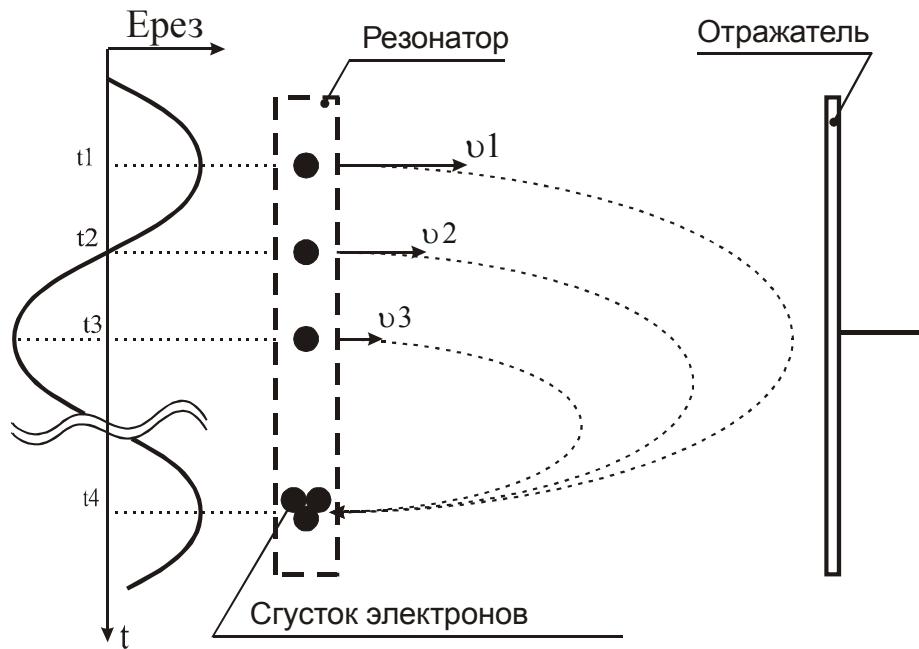


Рисунок 3. Процесс формирования сгустков.

При этом время пролета электронов должно быть таким, чтобы в момент возвращения в зазор резонатора (t_4 на рисунке 3) там существовало для них тормозящее поле. В этом случае электроны отдают энергию СВЧ полю резонатора, т. е. полю того же самого контура, при прохождении которого они модулировались по скорости (образуется положительная обратная связь, энергия возвращенного сгустка частично идет на модуляцию новых электронов).

Подобрав значения U_θ и U_{OTR} , можно добиться, чтобы сгусток отраженных электронов приходил к сеткам резонатора в тот момент, когда поле в зазоре тормозящее. В силу того, что вектор скорости возвращающихся электронов противоположен вектору скорости электронов, движущихся от катода, поле в зазоре будет тормозить сгусток, когда СВЧ -потенциал второй сетки по отношению к первой будет положительным. Пролетая между сетками резонатора в тормозящем поле, сгусток электронов отдает энергию СВЧ и поддерживает возникшие в резонаторе колебания.

Цель и задачи лабораторной работы

Целью данной лабораторной работы является ознакомление с устройством и принципом действия отражательного клистрона и экспериментальное исследование основных характеристик отражательного клистрона. В ходе лабораторной работы необходимо:

- снять зависимость мощности колебаний, генерируемых клистроном, от напряжения на ускоряющем электроде $P_k=f(U_0)$ (при $U_{otr}=const$).
- снять зависимость мощности и частоты генерируемых колебаний от напряжения на отражателе: $P_k=f(U_0)$ и $f=\varphi (U_{otr})$ (при $U_0=const$).

Описание лабораторной установки

Лабораторная установка для исследования характеристик отражательного клистрона изображена на рисунке 4. В состав лабораторной установки входят:

- блок питания (БП на рисунке 4) с плавной регулировкой напряжений, подаваемых на отражатель и резонатор (U_{otr} и U_0 соответственно);
- клистрон;
- волновод (на рисунке 4 изображен сплошной линией соединяющей все элементы схемы справа от клистрона);
- направленный ответвитель (**НО** на рисунке 4) ослабляет сигнал, поступающий на детектор, с постоянным коэффициентом ослабления α_{HO} , чтобы понизить мощность, подводимую к измерительной части схемы (лишняя энергия «гаситься» в **CH** – согласованной нагрузке);
- аттенюатор **Am** с регулируемым затуханием α_{AT} – для расширения диапазона измеряемых мощностей.
- ваттметр **P_{ДЕТ.}**, измеряющий мощность, выделяющуюся на детекторе **D** (в качестве индикатора в лабораторной установке используется миллиамперметр проградуированный в ваттах);
- резонансный частотомер **f**. (Для измерения **f** необходимо настроить частотомер в резонанс, добившись минимального показаниям ваттметра

$P_{\text{дет}}$. При настройке частотомера в резонанс на детектор поступает минимум СВЧ энергии.)

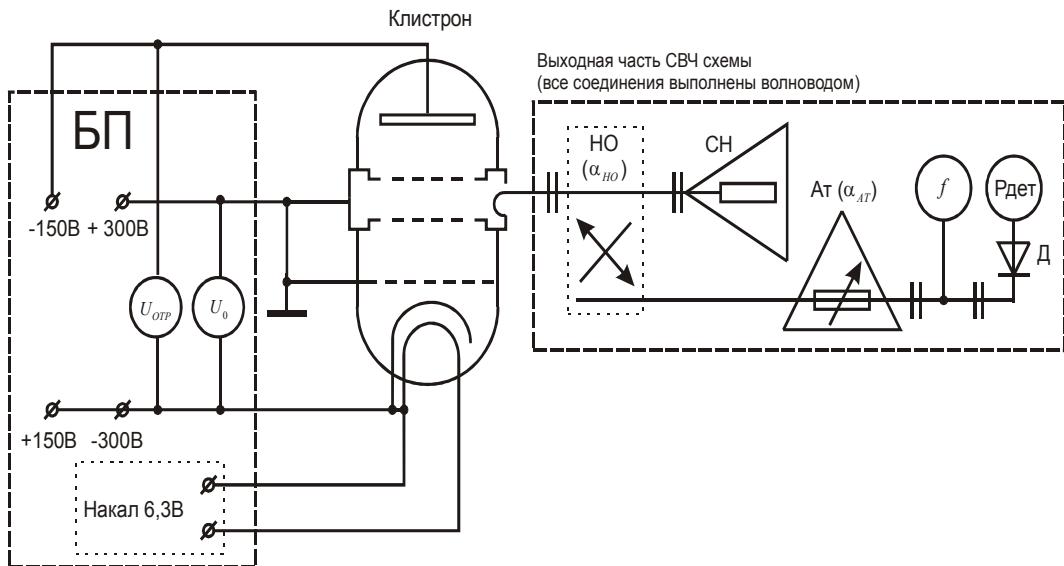


Рисунок 4. Лабораторная установка, (где - фланцевое соединение волноводов)

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТЫ

1. Снять зависимость $P_K=f(U_0)$ для постоянного значения напряжения на отражателе $U_{\text{отр}}$. В каждой зоне генерации необходимо произвести 6-10 измерений. По полученным экспериментальным данным построить зависимость $P_K=f(U_0)$ (см. Приложение рисунок П.1.).

Выбор значения $U_{\text{отр}}$.

Пробуются несколько вариантов значений напряжения $U_{\text{отр}}$ и проверяется по ваттметру, возможно ли получить характеристику с явно выраженным зонами генерации (см. Приложение рисунок П.1.).

Перед снятием характеристики для установленного $U_{\text{отр}}$ произвести установку затухания аттенюатора α_{AT} такой величины, чтобы на всем диапазоне изменения U_0 , стрелка амперметра не заходила за пределы измерения.

Измеренная мощность на детекторе пропорциональна мощности генерируемой криостроном $P_K = 10^{0.1\alpha_\Sigma} P_{ДЕТ}$

Таблица 1. Зависимость $P_K=f(U_0)$ ($U_{отр}=60$ В, $\alpha_{HO}=10$ дБ)

U_0 , В	$P_{ДЕТ}$, мкВт	α_{AT} , дБ	$\alpha_\Sigma = \alpha_{HO} + \alpha_{AT}$, дБ	P_K , мкВт

2. Снять зависимость мощности и частоты генерируемых колебаний от напряжения на отражателе $P_K=f(U_{отр})$, $f=\varphi(U_{отр})$ для одной из наиболее мощных зон генерации (выбрать по результатам предыдущего пункта), с постоянным значением укоряющего напряжения U_0 (соответствующему максимуму мощности в п. 1).

Таблица 2. Зависимости $P_K=f(U_{отр})$, $f=\varphi(U_{отр})$ ($U_0=200$ В, $\alpha_{HO}=10$ дБ)

$U_{отр}$, В	$P_{ДЕТ}$, мкВт	α_{AT} , дБ	$\alpha_\Sigma = \alpha_{HO} + \alpha_{AT}$, дБ	P_K , мкВт	f , ГГц

3. По данным таблицы 2 построить зоны генерации криострона $P_K=f(U_{отр})$ и зависимости $\Delta f=\varphi(U_{отр})$, где $\Delta f=f-f_0$, а f_0 – средняя частота диапазона, равная $0.5(f_{max}+f_{min})$ в данной зоне генерации.

Для каждой зоны генерации определить крутизну электронной настройки $S_{эл}=\Delta f/\Delta U_{отр}$, МГц/В и диапазон электронной настройки $2\Delta f_{эл}$ – изменение частоты колебания при изменении напряжения на отражателе криострона.

Приложение

Примеры заполнения таблиц и построения графиков.

Таблица П.1 – Зависимость $P_K = f(U_0)$ ($U_{omp} = 60B$, $\alpha_{ho} = 10\text{дБ}$)

$U_0, \text{В}$	$P_{ДЕТ}, \text{мкВт}$	$\alpha_{AT}, \text{дБ}$	$\alpha_{\Sigma} = \alpha_{HO} + \alpha_{AT}, \text{дБ}$	$P_K, \text{мкВт}$
75	1	0	10	10
80	3	0	10	30
85	2,5	0	10	25
90	1	0	10	10
95	0,5	0	10	5
100	3,5	0	10	35
110	10	0	10	100
120	13	0	10	130
130	17	0	10	170
140	16,5	0	10	165
150	10	0	10	100
160	2,5	0	10	25
165	0	0	10	0
170	5	0	10	50
180	25	0	10	250
190	44,5	0	10	445
200	59	0	10	590
210	69	0	10	690
220	60	0	10	600
230	45	0	10	450
240	30	0	10	300
250	16,5	0	10	165
260	0	0	10	0

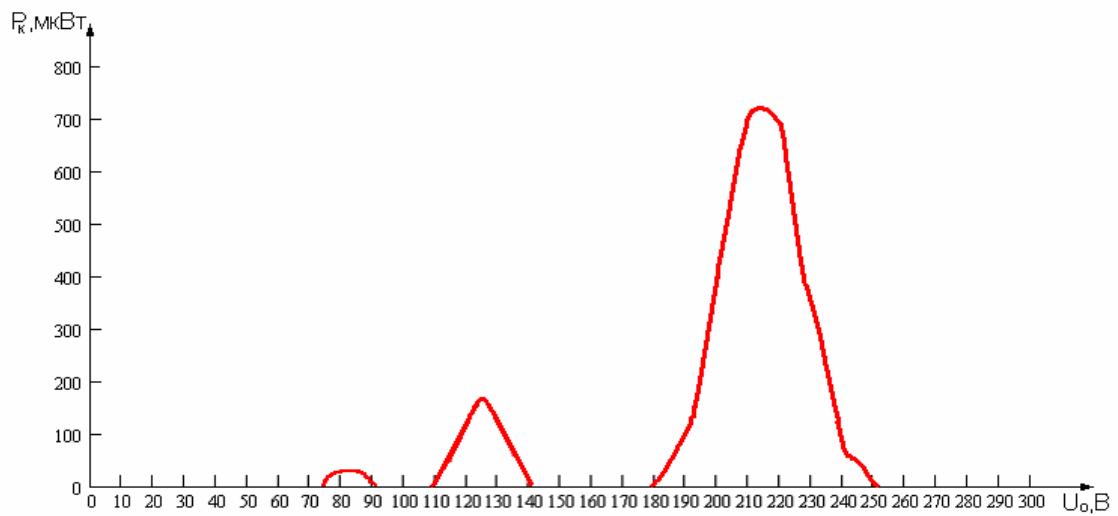


Рисунок П.1. Зависимость $P_K = f(U_0)$

Таблица П.2 – Зависимости $P_K = f(U_{OTP})$, $f = \varphi(U_{OTP})$ ($U_0 = 200B$, $\alpha_{ho}=10$ дБ)

U_{omp} , В	P_{DET} , мкВт	α_{AT} , дБ	$\alpha_{\Sigma} = \alpha_{HO} + \alpha_{AT}$, дБ	P_K , мкВт	f, ГГц	Δf , ГГц
30	0,5	10	20	50	11,087	0.1165
35	11	10	20	1100	11,170	0.0335
40	9	10	20	900	11,265	-0.0615
45	0,5	10	20	50	11,320	-0.1165
50	0	10	20	0		
55	15	10	20	1500	11,117	0.153
60	31	10	20	3100	11,162	0.108
65	18	10	20	1800	11,270	-0.100
70	10	10	20	1000	11,423	-0.153
80	0	10	20	0		
95	3	10	20	300	11,056	0.092
100	12	10	20	1200	11,065	0.083
105	25	10	20	2500	11,098	0.05
110	42	10	20	4200	11,136	0.012
115	46	10	20	4600	11,173	-0.025
120	40	10	20	4000	11,210	-0.062
125	23	10	20	2300	11,240	-0.092

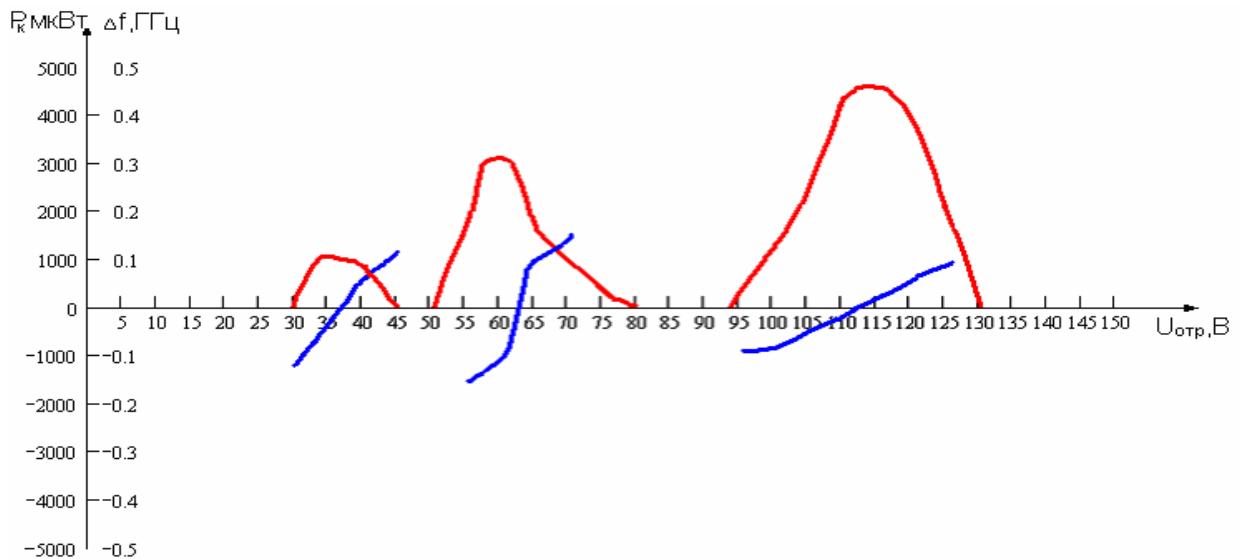


Рисунок П.2. Зависимости $P_K = f(U_{OTP})$, $f = \varphi(U_{OTP})$